



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种镁基植入材料微弧氧化自封孔活性涂层及其制备方法

文献类型: 专利

作者 甘俊杰; 谭丽丽; 杨柯; 李扬德; 李卫荣

发表日期 2015-06-10

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 甘俊杰; 谭丽丽; 杨柯; 李扬德; 李卫荣

公开日期 2015-06-10

申请日期 2012-04-27

语种 中文

专利申请号 201210127249.x

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/76682>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 甘俊杰,谭丽丽,杨柯,等. 一种镁基植入材料微弧氧化自封孔活性涂层及其制备方法. 2015-06-10.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

41

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。